

# 公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源修正公告草案總說明

行政院環境保護署（以下簡稱本署）依據空氣污染防治法第二十二條第一項規定，於八十二年起到一百零四年間陸續公告第一批至第四批「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」（以下簡稱本公告），規範經指定公告之固定污染源應連續監測其空氣污染物排放狀況，以利主管機關即時掌握該污染源排放情形。

為完整掌握大型污染源空氣污染物排放情形，本次修正增訂廢棄物焚化程序之二氧化硫監測項目，並納管鋼鐵冶煉業之金屬軋造程序加熱爐及鍛造用加熱爐等設備，以利加強管制；另為配合排放標準管制及環境影響評估法規定，使連續自動監測設施管制作業具一致性，依據「光電材料及元件製造業空氣污染管制及排放標準」、「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」、「膠帶製造業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」、「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」及環境影響評估法審查通過之書件所載內容及審查結論，評估其現行管制狀況，併入納管需裝設連續自動監測設施者，使公私場所落實執行固定污染源監測作業，依法確實執行連續自動監測設施例行性校正、連線及維護保養等作業，確保其監測數據之準確性及完備整體管理制度，俾利主管機關能確實且即時掌握該固定污染源空氣污染物排放情形，爰擬具「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」修正公告草案，其修正要點如下：

- 一、增訂第五批公私場所應完成設置連續自動監測設施及與主管機關連線之期限規定。（修正公告事項第三項）
- 二、修訂第二批與第四批廢棄物焚化程序之應監測項目，增訂二氧化硫監測項目，以確實掌握該污染源之污染排放情形。（修正公告事項第一項附表）
- 三、增訂鋼鐵冶煉業金屬軋造程序之加熱爐及鍛造用加熱爐等設備為管制對象，規範其應監測不透光率、二氧化硫、氮氧化物、氧氣及排放流率等項目，以確實掌握該污染源之污染排放情形。（修正公告

事項第一項附表)

- 四、配合「光電材料及元件製造業空氣污染管制及排放標準」第七條規範，整併納管公私場所內所有製程之排放管道之揮發性有機物單位小時許可排放量一·三公斤以上者為管制對象，並明定其應監測排放流率及揮發性有機物項目，以利管制規範一致。(修正公告事項第一項附表)
- 五、配合「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」第五條規範，整併納管公私場所內所有製程之排放管道之揮發性有機物單位小時許可排放量0·六公斤以上者為管制對象，並明定其應監測排放流率及揮發性有機物項目，以利管制規範一致。(修正公告事項第一項附表)
- 六、配合「膠帶製造業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」第六條規範，整併納管公私場所內所有製程之含揮發性有機物原(物)料年許可用量五十公噸以上且所有製程之排放管道之揮發性有機物單位小時許可排放量六公斤以上者為管制對象，並明定其應監測排放流率及揮發性有機物等項目，以利管制規範一致。(修正公告事項第一項附表)
- 七、配合「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」第六條規範，納管具有石化製程使用之廢氣燃燒塔為管制對象，並明定其應監測排放流率、各碳數非甲烷碳氫化合物、高反應性揮發性有機物種及總還原硫項目，以利管制規範一致。(修正公告事項第一項附表)
- 八、增訂依據環境影響評估法審查通過之書件所載內容及審查結論載明應設置連續自動監測設施且已申請固定污染源設置許可證或已建造完成者為管制對象，並明定其應監測項目係依據環境影響評估法審查通過之書件所載內容及審查結論載明應設置連續自動監測設施之監測項目進行設置及連線。(修正公告事項第一項附表)

## 公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源修正公告對照表

| 修正公告  | 現行公告  | 說明   |
|---|---|--|
| 主旨：修正「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」，並自即日起生效。   | 主旨：修正「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」，並自即日起生效。   | 公告主旨未修正。   |
| 依據：空氣污染防制法第二十二條第一項。   | 依據：空氣污染防制法第二十二條第一項。   | 公告依據未修正。   |
| 公告事項：<br>一、公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，如附表。   | 公告事項：<br>一、公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，如附表。   | 本項未修正。   |
| 二、本公告應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，各批次原公告日前已設立者，應依各批次原公告應完成連續自動監測設施設置及與主管機關連線之期限辦理；各批次原公告日後新設者，應自原公告日起依規定辦理。各批次原公告日期如下：<br>(一)第一批公私場所應設置連續自動監測設施之固定污染源公告日期為：中華民國八十二年十月十六日。<br>(二)第一批公私場所應與主管機關連線之 | 二、本公告應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，各批次原公告日前已設立者，應依各批次原公告應完成連續自動監測設施設置及與主管機關連線之期限辦理；各批次原公告日後新設者，應自原公告日起依規定辦理。各批次原公告日期如下：<br>(一)第一批公私場所應設置連續自動監測設施之固定污染源公告日期為：中華民國八十二年十月十六日。<br>(二)第一批公私場所應與主管機關連線之 | 因第四批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源已於一百零四年十二月二十五日公告，爰將原公告事項第三項內容酌作文字修正，並移列至第五款，以符立法體例。 |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>固定污染源公告日期為：中華民國九十一年二月十九日。</p> <p>(三)第二批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源公告日期為：中華民國九十一年七月十七日。</p> <p>(四)第三批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源公告日期為：中華民國九十二年三月二十七日。</p> <p><u>(五)第四批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源公告日期為：中華民國一百零四年十二月二十五日。</u></p> | <p>固定污染源公告日期為：中華民國九十一年二月十九日。</p> <p>(三)第二批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源公告日期為：中華民國九十一年七月十七日。</p> <p>(四)第三批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源公告日期為：中華民國九十二年三月二十七日。</p> |  |
| <p>三、<u>第五</u>批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源皆屬公告後應設置及連線對象，其應完成期限依固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法規定辦理。</p>   | <p>三、<u>第四</u>批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源皆屬公告後應設置及連線對象，其應完成期限依固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法規定辦理。</p>  | <p>修正本次公告應設置及連線對象皆屬公告後應設置及連線對象，其設置及連線完成時間仍須依固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第七條及第八條規定辦理。</p> |







|   |            |        |            |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------|--------|------------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 五 | 鋼鐵冶煉業      | 金屬軋造程序 | 加熱爐及鍛造用加熱爐 | 屬同一排放口，且固定污染源操作許可證核定總輸入熱值在五仟萬仟卡／小時以上者。         | ● | ● | ● | ● | ● |   |  |  |  |  |  |  |  | 一、本項新增。<br>二、為擴大納管固定污染源，掌握其排放情形，增訂納管鋼鐵冶煉業之金屬軋造程序加熱爐及鍛造用加熱爐固定污染源為管制對象，並規範其應監測項目。    |
| 五 | 光電材料及元件製造業 | 各程序    | 各污染源       | 公私場所內所有製程之揮發性有機物單位小時許可排放量一．三公斤以上者。             |   |   |   |   | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | 一、本項新增。<br>二、配合「光電材料及元件製造業空氣污染管制及排放標準」，整併納管需裝設連續自動監測設施管制對象，並說明應監測項目之相關規定。          |
| 五 | 半導體製造業     | 各程序    | 各污染源       | 公私場所內所有製程之揮發性有機物單位小時許可排放量〇．六公斤以上者。             |   |   |   |   | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | 一、本項新增。<br>二、配合「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」，並評估現行管制及衝擊狀況，併入納管需裝設連續自動監測設施管制對象，並說明應監測項目之相關規定。 |
| 五 | 膠帶製造業      | 各程序    | 各污染源       | 公私場所內所有製程之揮發性有機物原料年許可量五十公噸以上且所有製程之揮發性有機物單位小時許可 |   |   |   |   | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | 一、本項新增。<br>二、配合「膠帶製造業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」，整併納管需裝設連續自動監測設施管制對象，並說明應監測項目之              |





|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>所固定<br/>污染源<br/>同時屬<br/>本公告<br/>第一批<br/>至第五<br/>批之管<br/>制對象<br/>者，其<br/>監測項<br/>目亦須<br/>符合所<br/>屬之監<br/>測項目。</p> | <p>應設置連續自動<br/>監測設施之監測<br/>項目種類繁多，<br/>部分監測項目尚<br/>未有相對應之監<br/>測設施性能規範<br/>可供依循，故規<br/>範非屬固定污染<br/>源空氣污染物連<br/>續自動監測設施<br/>管理辦法第三條<br/>之量測項目者，<br/>不適用本公告。</p> <p>四、配合相關排放標<br/>準管制及為使新<br/>增納管對象得以<br/>連續自動監測設<br/>施之監測數據計<br/>算空氣污染物排<br/>放量，爰增訂應<br/>監測排放速率及<br/>環境影響評估書<br/>件所載內容及審<br/>查結論載明應監<br/>測項目包含二氧<br/>化硫、總還原<br/>硫、氮氧化物、<br/>氯化氫或一氧化<br/>碳監測項目者，<br/>如燃燒過程或特<br/>定行業標準另有<br/>規定污染物濃度<br/>含氧校正計算，<br/>應同時設置氧氣<br/>監測設施。</p> <p>五、考量公私場所屬<br/>於環境影響評估<br/>書件所載內容及<br/>審查結論載明應<br/>設置連續自動監<br/>測設施者，亦可能<br/>同時符合公告</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

